

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表

設 置 者 名	
施 設 名 称	
設 置 場 所	
問 合 せ 先	

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）の規定に基づき、維持管理に関する情報を公表します。

（産業廃棄物処理施設の維持管理等）

法第十五条の二の三第二項 次の産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であって環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

1 廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

設置又は変更の許可申請書、軽微な変更等の届出書、設置の届出書に記載すべき事項	別添のとおり
--	--------

2 廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報

（公表すべき維持管理の状況に関する情報）

第十二条の七の二 法第十五条の二の三第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。

環境省令の該当する号	施設の種類	公表事項
第五号	廃 P C B 処理施設	以下のとおり

イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

(状況： 年度分 公表の期限：翌月の末日)

産業廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
廃ポリ塩化ビフェニル等												
ポリ塩化ビフェニル処理物												
ポリ塩化ビフェニル汚染物												

ロ(1) 前条第十四項第二号ハ、第三号ハ、第四号ハ、第五号ハ、ニ及びホ(2)並びに第六号ニの規定による測定に関する次に掲げる事項

(状況： 年度分 公表の期限：測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日)

廃ポリ塩化ビフェニル等（ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。）又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設（PCB汚染物分解施設を除く）		測定を行った位置	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
脱塩素化分解方式の施設	反応中の混合物の温度			
水熱酸化分解方式の施設	反応中の混合物の温度			
	反応器中の圧力			
還元熱化学分解方式の施設	反応設備内の温度			
	反応設備内の圧力			
	薬剤として用いられるガスの供給量			
光分解方式の施設	照射される光の強度			
	反応中の混合物の温度			
	反応終了後の混合物の処理（生物分解及び脱塩素化分解に限る。）については、反応中の混合物の温度			
プラズマ分解方式の施設	プラズマの発生に必要なガスの供給量			
	プラズマの発生に必要な電流			
	プラズマの発生に必要な電圧			
	反応器の出口の生成ガスの温度			
	反応器内の圧力			
	反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量			

ロ(2) 第十五項第二号二、第三号二、第四号二並びに第五号二及びホの規定による測定に関する次に掲げる事項

(状況： 年度分 公表の期限：測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日)

廃ポリ塩化ビフェニル等（ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。）又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設（PCB汚染物分解施設に限る）		測定を行った位置	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
水熱酸化分解方式の施設	反応中の混合物の温度			
	反応器中の圧力			
還元熱化学分解方式の施設	反応設備内の温度			
	反応設備内の圧力			
	反応設備内の薬剤として用いられるガスの供給量			
機械化学分解方式の施設	反応中の反応器内の温度			
	反応器の回転数			
熔融分解方式の施設	反応設備内の温度			
	反応設備内の圧力			
	除去設備内の生成ガスの温度			

ロ(3) 第十六項第三号ハ及びホの規定による測定に関する次に掲げる事項

(状況： 年度分 公表の期限：測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日)

ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設		測定を行った位置	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
分離方式の施設	分離設備内の温度			
	分離設備内の圧力			
	回収設備の温度			

ハ(1) 前条第十四項第二号二、第三号ホ、第四号ホ及びル、第五号へ並びに第六号へ及びヲの規定による測定に関する次に掲げる事項

(状況： 年度分 公表の期限：測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日)

廃ポリ塩化ビフェニル等（ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。）又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設（PCB汚染物分解施設を除く）	測定に係る試料を採取した位置	測定に係る試料を採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
--	----------------	-----------------	---------------	-------

脱塩素化分解方式の施設	廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理により生じた廃油中のポリ塩化ビフェニル含有量	(1回目)				
		(2回目)				
脱塩素化分解方式の施設（処理に伴い生ずる排水を放流する場合）は前項に加えて	放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量	(1回目)				
		(2回目)				
	放流水中のノルマルヘキサン抽出物質含有量	(1回目)				
		(2回目)				
	放流水中の水素イオン濃度	(1回目)				
		(2回目)				
水熱酸化分解方式の施設（処理に伴い生ずる排水を放流する場合）	放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量	(1回目)				
		(2回目)				
	放流水中のノルマルヘキサン抽出物質含有量	(1回目)				
		(2回目)				
	放流水中の水素イオン濃度	(1回目)				
		(2回目)				
還元熱化学分解方式の施設	除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分					
還元熱化学分解方式の施設（処理に伴い生ずる排水を放流する場合）は前項に加えて	放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量	(1回目)				
		(2回目)				
	放流水中のノルマルヘキサン抽出物質含有量	(1回目)				
		(2回目)				
	放流水中の水素イオン濃度	(1回目)				
		(2回目)				
光分解方式の施設（処理に伴い生ずる排水を放流する場合）	放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量	(1回目)				
		(2回目)				

合)	放流水中のノルマルヘキサン抽出物質含有量	(1回目)				
		(2回目)				
	放流水中の水素イオン濃度	(1回目)				
		(2回目)				
プラズマ分解方式の施設	除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分					
プラズマ分解方式の施設（処理に伴い生ずる排水を放流する場合）は前項に加えて	放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量	(1回目)				
		(2回目)				
	放流水中のノルマルヘキサン抽出物質含有量	(1回目)				
		(2回目)				
	放流水中の水素イオン濃度	(1回目)				
		(2回目)				

ハ(2) 前条第十五項第二号へ、第三号へ及びヲ、第四号又並びに第五号ト及びワの規定による測定に関する次に掲げる事項

(状況： 年度分 公表の期限：測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日)

廃ポリ塩化ビフェニル等（ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。）又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設（PCB 汚染物分解施設に限る）			測定に係る試料を採取した位置	測定に係る試料を採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
水熱酸化分解方式（処理に伴い生ずる排水を放流する場合）	放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量	(1回目)				
		(2回目)				
	放流水中のノルマルヘキサン抽出物質含有量	(1回目)				
		(2回目)				
	放流水中の水素イオン濃度	(1回目)				
		(2回目)				
還元熱化学分解方式	除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分					
還元熱化学分解方式の施設（処理に伴い生ずる排水を放	放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量	(1回目)				
		(2回目)				

流する場合)は前項に加えて	放流水中のノルマルヘキサン抽出物質含有量	(1回目)				
		(2回目)				
	放流水中の水素イオン濃度	(1回目)				
		(2回目)				
機械化学分解方式の施設(処理に伴い生ずる排水を放流する場合)	放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量	(1回目)				
		(2回目)				
	放流水中のノルマルヘキサン抽出物質含有量	(1回目)				
		(2回目)				
	放流水中の水素イオン濃度	(1回目)				
		(2回目)				
溶融分解方式の施設	除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分					
溶融分解方式の施設(処理に伴い生ずる排水を放流する場合)は前項に加えて	放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量	(1回目)				
		(2回目)				
	放流水中のノルマルヘキサン抽出物質含有量	(1回目)				
		(2回目)				
	放流水中の水素イオン濃度	(1回目)				
		(2回目)				

ハ(3) 前条第十六項第二号の規定によりその例によることとされる第十四項第三号ホ並びに第十六項第三号ヘ及びチの規定による測定に関する次に掲げる事項

(状況: 年度分 公表の期限: 測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日)

ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設			測定に係る試料を採取した位置	測定に係る試料を採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
洗浄方式の施設(処理に伴い生ずる排水を放流する場合)	放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量	(1回目)				
		(2回目)				

は前項に加えて	放流水中のノルマルヘキサン抽出物質含有量	(1回目)				
		(2回目)				
	放流水中の水素イオン濃度	(1回目)				
		(2回目)				
分離方式の施設	ポリ塩化ビフェニルの分離及び回収の後に生ずる回収液の量					
	排出した回収液の量					
	当該回収液中のポリ塩化ビフェニル含有量					

ニ 前条第十四項第四号ニ及び第六号ホ並びに第十五項第三号ホ、第四号ホ及び第五号への規定による粒子状の物質等の除去を行った年月日

(状況： 年度分 公表の期限：除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日)

項 目		除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去を行った年月日
廃ポリ塩化ビフェニル等（ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。）又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設（ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設を除く。）	還元熱化学分解方式の施設	
	プラズマ分解方式の施設	
廃ポリ塩化ビフェニル等（ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。）又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設（ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設に限る。）	還元熱化学分解方式の施設	
	機械化学分解方式の施設	
	熔融分解方式の施設	

ホ(1) 廃ポリ塩化ビフェニル等（ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。）又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設（ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設を除く。）（前条第十四項第四号チ及び第六号リ）の規定による測定に関する次に掲げる事項

(状況： 年度分 公表の期限：測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日)

項 目	測定に係る生成ガ	測定に係る生成ガス	測定の結果の得	測定
-----	----------	-----------	---------	----

			スを採取した位置	を採取した年月日	られた年月日	結果
還元熱化学分解方式の施設	除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度					
	除去設備の出口における生成ガス中の粒子状の物質	(1回目)				
		(2回目)				
	除去設備の出口における生成ガス中の塩化水素の濃度	(1回目)				
		(2回目)				
プラズマ分解方式の施設	除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度					
	除去設備の出口における生成ガス中の粒子状の物質	(1回目)				
		(2回目)				
	除去設備の出口における生成ガス中の塩化水素の濃度	(1回目)				
		(2回目)				

ホ(2) 廃ポリ塩化ビフェニル等（ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。）又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設（ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設に限る。）前条第十五項第三号リ、第四号ト及び第五号ヌの規定による測定に関する次に掲げる事項

（状況： 年度分 公表の期限：測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日）

項 目			測定に係る生成ガスを採取した位置	測定に係る生成ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
還元熱化学分解方式の施設	除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度					
	除去設備の出口における生成ガス中の粒子状の物質	(1回目)				
		(2回目)				
	除去設備の出口における生成ガス中の塩化水素の濃度	(1回目)				
		(2回目)				
機械化学分解方式の施設	除去設備の出口における生成ガス中の粒子状の物質	(1回目)				
		(2回目)				
	除去設備の出口における生成ガス中の塩化水素の濃度	(1回目)				
		(2回目)				
熔融分解方	除去設備の出口における生成ガ					

式の施設	ス中のダイオキシン類の濃度					
	除去設備の出口における生成ガス中の粒子状の物質	(1回目)				
		(2回目)				
	除去設備の出口における生成ガス中の塩化水素の濃度	(1回目)				
		(2回目)				